

# カスタムPtfеウェハ-ハンドリングラック 耐食性 高温半導体ポリシリコン加工スタンド

商品番号: PL-CP287



## 前書き

過酷な化学環境および高温半導体プロセス用に設計されたプレミアムカスタムPTFEウェハースタンド。これらの耐食性キャリアは、重要なポリシリコン、太陽光発電、および高度な電子機器製造ワークフローにおいて、高純度ハンドリング、低摩擦操作、並外れた耐久性を保証します。

## [詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
シリコンウェハ-エッチング	侵食性の高いフッ化水素酸と硝酸の混合液への浸漬中、シリコンウェハ-を安全に保持。	卓越した耐酸性とゼロ汚染。
RCA洗浄プロセス	アンモニアと過酸化水素を含む多段階洗浄シーケンスにおけるキャリアとして使用。	強力な酸化剤による劣化に耐える。
太陽電池生産	太陽光発電産業におけるドーピングおよび表面テクスチャリングプロセス中の光起電性基板の支持。	高い熱安定性と化学的不活性。
ポリシリコンインゴットハンドリング	精製および分析中の高純度ポリシリコン片の配置管理。	金属イオン溶出および表面接触損傷を防止。
微量分析用実験器具	分析化学における高純度サンプルの保管および輸送用の特殊ラックとして機能。	最高レベルのサンプル完全性と純度を保証。
半導体ウェットベンチ	大量基板洗浄およびすすぎのための自動化ウェットプロセスシステムへの統合。	低摩擦によりスムーズな自動ハンドリングを促進。
電気メッキ用治具	精密電気めっきプロセス中の非導電性で耐薬品性のサポートとして機能。	電気絶縁性と化学的安定性の組み合わせ。

パラメータ	仕様詳細
製品識別	PL-CP287
基本材料	高純度ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
製造プロセス	精密CNC加工 / カスタムファブリケーション
カスタマイズ対応	ユーザー仕様完全に特注可能
温度範囲	-200°C ~ +260°C
化学的適合性	普遍的 (ほとんどの酸、塩基、溶剤に対して不活性)
表面仕上げ	高平滑、非粘着性、疎水性
スロット構成	幅、深さ、ピッチをカスタマイズ可能
負荷容量	基板密度と数量に合わせて調整
汚染管理	金属フリー、添加剤フリー構造
寸法	顧客要件に応じてカスタム設計